Rec's PET/ETO 1 9 MAY 20054

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

10/535448

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



- 1 COLD BUILDE IN CONTRACTOR AND BUILD AND AND AND BUILD HOUR HOUR BUILD AND A COLD CONTRACTOR AND A COLD THE

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003770

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 953.7

19. November 2002 (19.11.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX,

Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055, 90014 Nürnberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.



Beschreibung

5

10

15

20

25

30

35

Organisches elektronisches Bauelement mit strukturierter halbleitender Funktionsschicht und Herstellungsverfahren dazu

Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein
Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht
des Bauelements strukturiert ist.

Bei organischen elektronischen Bauelementen werden die organischen halbleitenden Funktionsschichten üblicherweise großflächig durch Spin-coating, Aufsprühen, Rakeln oder ähnliches als homogene großflächige aber sehr dünne Funktionsschichten aufgebracht.

Bei einer integrierten Schaltung kann das zu Problemen führen, da Leckströme von einem Bauelement oder von einer Elektrode zur nächsten entstehen, wenn die halbleitenden Funktionsschichten der Bauelemente aneinander stoßen. Diese Leckströme stören die Performance der Schaltung zum Teil erheblich. Deshalb werden Versuche unternommen, die halbleitenden Funktionsschichten zu strukturieren und/oder sie auf die aktiven Flächen, also die Bereiche wo sich Stromkanäle ausbilden, zu reduzieren. Diese Strukturierung kann bei photolithographisch hergestellten Bauelementen durch entsprechende Belichtungsmasken erreicht werden. Für eine breite Anwendung werden aber photolithographisch hergestellte Bauelemente zu teuer. Deshalb wird bei der Entwicklung der Elemente auf preisgünstige Druckherstellungsmethoden fokussiert.

Die halbleitende Funktionsschicht kann jedoch nicht durch herkömmliche Druckmethoden strukturiert aufgebracht werden, weil diese Schicht sehr dünn sein muss (typischerweise kleiner 100nm), damit sie funktioniert. Die beispielsweise für die halbleitende Funktionsschicht geforderten Schichtdicken

20

30

35

sind herkömmlicherweise nur über Belackung wie Coating, Aufsprühen etc. zu erreichen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei gedruckt hergestellten organischen elektronischen Bauelementen eine
Strukturierung einer dünnen, insbesondere der halbleitenden
Funktionsschicht zu ermöglichen, ohne dass dabei die Schichtdicke der betroffenen Funktionsschicht gegenüber einer normalerweise durch Belackung (Coating, Aufsprühen, Einrakeln)
hergestellten, z.B. halbleitenden, Funktionsschicht gesteigert wird.

Gegenstand der Erfindung ist ein organisches elektronisches Bauelement mit einer strukturierten halbleitenden Funktionsschicht einer Dicke kleiner 100nm, wobei die Strukturierung dadurch entsteht, dass eine untere Funktionsschicht nur partiell mit dem organischen Funktionsmaterial der nächsten Funktionsschicht benetzt wird. Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauelements, bei dem durch gezielte Behandlung einer unteren Funktionsschicht eine obere Funktionsschicht trotz großflächiger Auftragung strukturiert erzeugt wird.

Nach einer Ausführungsform des Verfahrens wird eine halblei-25 tende Schicht strukturiert erzeugt.

Nach einem Ausführungsbeispiel wird die untere Funktionsschicht durch einen Lack partiell abgedeckt, der durch Drucken in ganz geringer Schichtdicke aufbringbar ist.

Als obere, strukturierte Funktionsschichten können durch das Verfahren halbleitende, isolierende, und/oder leitende organische Funktionsschichten, aber natürlich auch anorganische Funktionsschichten, wie z.B. dünne Metallschichten strukturiert hergestellt werden.

Die untere Funktionsschicht ist je nach Aufbau des organischen elektronischen Bauelements und der oberen Schicht das Substrat, eine leitende Funktionsschicht etc.

Als "gezielte Behandlung" wird die partielle Abdeckung 5 und/oder die lokale Veränderung der unteren Funktionsschicht bezeichnet, die bewirkt, dass in ausgewählten Bereichen der unteren Funktionsschicht beim Belacken mit dem Material Benetzung stattfindet oder vermieden wird (also "partielle Benetzung" stattfindet), kann mittels einer Druckmethode, durch 10 Laserbehandlung, Wärmebehandlung, andere physikalische, elektrische oder chemische Behandlung, immer jedoch partiell und mit einer Auflösung im µm-Bereich, erfolgen. Beispielhaft genannt sei die partielle Kontaktierung mit Säure/Base oder anderen reaktiven chemischen Substanzen, physikalische Effek-15 te wie Licht, Wärme, Kälte und schließlich die mechanische Behandlung wie Reiben. Die Folge der Behandlung ist in jedem Falle die, dass die nächste Funktionsschicht auf den behandelten Stellen nicht oder nur dort benetzt.

20

Der Begriff "organisches Material" und/oder "Funktionspolymer" umfasst hier alle Arten von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen Kunststoffen, die im Englischen z.B. mit "plastics" bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium), und der typischen metallischen Leiter. Eine Beschränkung im dogmatischen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf die Molekülgröße, insbesondere auf polymere und/oder oligomere Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der Einsatz von "small molecules" möglich.

Im folgenden wird die Erfindung noch anhand zweier Figuren, die eine Draufsicht und einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen organischen elektronischen Bauteils zeigen:

5

10

15

35

Figur 1 zeigt eine Aufsicht auf eine Schaltung mit einer strukturierten halbleitenden Funktionsschicht. Zu sehen ist eine organische Schaltung, die auf einem Substrat (verdeckt) aufgebaut ist. Es sind mehrere aktive Elemente wie organische Feld-Effekt-Transistoren nebeneinander angeordnet, zu erkennen sind jeweils die Source/Drain Elektroden 2. Der schraffierte Bereich zeigt die organische Halbleiterschicht 1, die strukturiert ist und Teilbereiche 3 hat, die frei von halbleitendem Funktionsmaterial sind. Durch den freien Bereich 3 ("frei" heißt hier weder mit leitendem noch mit halbleitendem Material bedeckt) wird ein Leckstrom vom linken in den rechten Bereich der Schaltung unterdrückt.

Figur 2 zeigt einen OFET mit dem Substrat 4 und den Source/Drain Elektroden 2. Auf der leitenden Funktionsschicht,
den Source/Drain Elektroden 2 befindet sich die strukturierte
halbleitende Funktionsschicht 1, die sich nicht ganzflächig
über die leitende Funktionsschicht 2 erstreckt, sondern die
durch den Lack 6, der das Substrat 4 partiell gegen die Benetzung mit halbleitender Funktionsschicht 1 abdeckt, unterbrochen, also strukturiert nur die aktiven Flächen, das heißt
die Flächen oberhalb der Source/Drain Elektroden, bedeckt.
Die halbleitende Funktionsschicht ihrerseits wird durch die
isolierende Funktionsschicht 5 bedeckt, auf der sich die Gate-Elektroden 7 befinden.

Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei eine dünne Schicht, wie die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht

durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.

Patentansprüche

- 1. Organisches elektronisches Bauelement mit einer strukturierten Funktionsschicht einer Dicke kleiner 100nm, wobei die Strukturierung dadurch entsteht, dass eine untere Funktionsschicht nur partiell mit dem organischen Funktionsmaterial der nächsten Funktionsschicht benetzt wird.
- 2. Organisches elektronisches Bauelement nach Anspruch 1, bei 10 dem die strukturierte Funktionsschicht eine halbleitende Funktionsschicht ist.
- 3. Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauelements, bei dem durch gezielte Behandlung einer unteren Funktionsschicht eine obere Funktionsschicht trotz großflächiger Auftragung strukturiert erzeugt wird.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem eine halbleitende Funktionsschicht strukturiert erzeugt wird.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die untere Funktionsschicht durch einen Lack partiell abgedeckt wird, der durch Drucken in ganz geringer Schichtdicke aufbringbar ist.

20

FIG 1

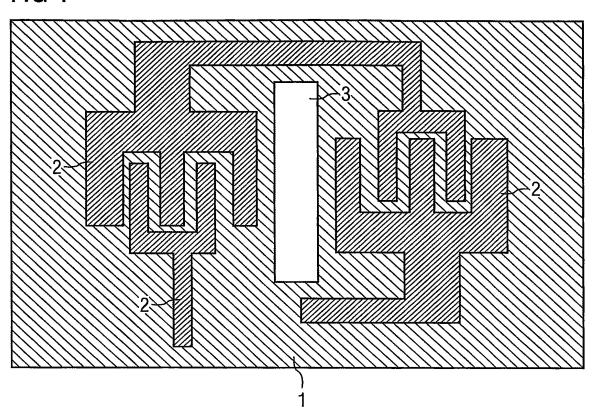
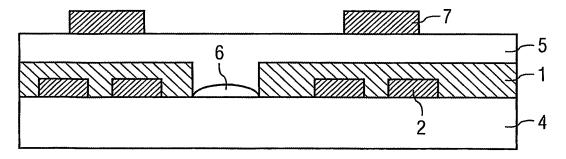


FIG 2



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



10/535448

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷:

H01L 51/20

PCT/DE2003/003770

ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055,

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

- (21) Internationales Aktenzeichen:
 - adatum:
- (22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 953.7

19. November 2002 (19.11.2002) I

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

Recherchenberichts:

90014 Nürnberg (DE).

2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.



A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L51/20		
		•	
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED currentation searched (classification system followed by classification system followed by classifi	tion symbole)	
IPC 7	H01L	ion symbolsy	
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields se	erched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search terms used)
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Dat	.a 	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	elevant passages	Relevant to claim No.
Х	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPL 25 November 1999 (1999-11-25) column 3, line 10 - line 25 column 9, line 47 - line 62 the whole document	1–5	
Х	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENN) TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISF (GB); F) 28 October 1999 (1999-1996 6 the whole document	1-5	
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS PAL) 27 March 2003 (2003-03-27) paragraph '0101! the whole document	HENNING ET	1–5
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.
	ategories of cited documents:	*T* later document published after the International Programme To the International Programme	
consi	nent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international	or priority date and not in conflict will cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the	n the application but seory underlying the
filing filing filing file file file file file file file file	date ent which may throw doubts on priority claim(s) or n is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the deservation of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or m	of be considered to ocument is taken alone claimed invention oventive step when the
other	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patent	ous to a person skilled
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	
	17 May 2004	27/05/2004	
Name and	malling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Far. (+31-70) 340-3016	Bader, K	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ation on patent family members

International	Application No
PCT.	03/03770

Pa cited	atent document I in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE	19918193	A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
				GB	2336553 A ,	
				JP	2000202357 A	25-07-2000
WO	9954936	Α	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
				AU	3614399 A	08-11-1999
				BR	9909580 A	19-12-2000
				CA	2328094 A1	28-10-1999
				CN	1301400 T	27-06-2001
				ΕP	1074048 A1	07-02-2001
				MO	9954936 A1	28-10-1999
				JP	2002512451 T	23-04-2002
				TW	498395 B	11-08-2002
			ہے میں رہا نہیں ہے وقت کانا وی رہے ہیں ہے کہ کا می	US	6603139 B1	05-08-2003
บร	2003059987	A1	27-03-2003	ΑU	2015901 A	03-07-2001
				AU	2016001 A	03-07-2001 03-07-2001
				AU	2206601 A	03-07-2001
				AU BR	2206901 A 0016643 A	03-07-2001
				BR	0016643 A	25-02-2003
				BR	0016661 A	25-02-2003
				BR	0016670 A	24-06-2003
				CA	2394881 A1	28-06-2001
				CA	2394886 A1	28-06-2001
				CA	2394895 A1	28-06-2001
				CA	2395004 A1	28-06-2001
				CN	1425201 T	18-06-2003
				CN	1425202 T	18-06-2003
				CN	1425203 T	18-06-2003
				CN	1425204 T	18-06-2003
				ΕP	1243032 A2	25-09-2002
				EP	1243033 A1	25-09-2002
				EP	1243034 A1	25-09-2002
				EP	1243035 A2	25-09-2002
				WO	0147043 A1	28-06-2001
				WO	0146987 A2	28-06-2001
				WO	0147044 A2	28-06-2001
				MO	0147045 A1	28-06-2001 03-06-2003
				JP	2003518332 T	10-06-2003
				JP JP	2003518754 T 2003518755 T	10-06-2003
				JP	2003518756 T	10-06-2003
				US	2003059984 A1	27-03-2003
				US	2003059904 A1 2003059975 A1	
				US	2003060038 A1	
				TW	552668 B	11-09-2003

A. KLASSIF	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/20		
TLK \	Unif 21/50		
		Stratic madden (mid	
	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi	fikation und der IPK	
B. RECHER	ICHIERTE GEBIETE Ler Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)	
IPK 7			
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die recherchierten Gebiete f	allen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)
EPO-Int	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
		(TEOU)	1 E
Х	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLA) 25. November 1999 (1999-11-25)	(IECH)	1–5
	Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 25		
	Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 62		
	das ganze Dokument		
l _x	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING	a ;	1-5
"	TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPLA	AY TECH	
	(GB); F) 28. Oktober 1999 (1999-10) Seite 6	0-28)	
	das ganze Dokument		
ļ :	um nan arasan saf	INITALA CT	1 6
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HE AL) 27. März 2003 (2003-03-27)	NNING ET	1-5
	Absatz '0101!		
1	das ganze Dokument		
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
		"T" Spätere Veröffentlichung, die nach den oder dem Prioritätsdatum veröffentlich	tworden ist und mit der
aber	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips	ır zum Verstandnıs des der
Anme		Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede	utung; die beanspruchte Erfindung
echel	entlichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- inen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein aufgrund dieser Veröffentli erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	achtet werden
soll o	ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eführt)	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung mit	keit neninend netrachtet
'O' Veröff	fentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser Kategorie ir diese Verbindung für einen Fachmanr	n Verbingiing gebracht wird und
"P" Veröff	entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*& Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	n Patentfamilie ist
	s Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Ro	echerchenberichts
	17. Mai 2004	27/05/2004	•
Name und	i Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Bader, K	•

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentucnung zur selben Patentfamilie gehören

In atlonales Aktenzeichen
PC 03/03770

	echerchenbericht tes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE	19918193	Α	25-11-1999	DE	19918193	A1	25-11-1999
VL.	17710170	• •	<u> </u>	GB	2336553		27-10-1999
				ĴΡ	2000202357	A	25-07-2000
WO	9954936	Α	28-10-1999	AU	766162		09-10-2003
				AU	3614399		08-11-1999
				BR	9909580		19-12-2000
				CA	2328094		28-10-1999
				CN			27-06-2001
				EP	1074048		07-02-2001
				WO	9954936		28-10-1999
				JP	2002512451		23-04-2002
				TW	498395		11-08-2002
				US	6603139	B1	05-08-2003
	200205002		27_02_2002	AL1	2015901	Δ	03-07-2001
US	2003059987	A1	27-03-2003	AU AU	2016001		03-07-2001
				AU	2206601		03-07-2001
				AU	2206901		03-07-2001
	•			BR	0016643		07-01-2003
				BR	0016660		25-02-2003
				BR	0016661		25-02-2003
				BR	0016670		24-06-2003
				CA	2394881		28-06-2001
				CA	2394886		28-06-2001
				CA	2394895		28-06-2001
				CA	2395004		28-06-2001
				CN	1425201		18-06-2003
				CN	1425202		18-06-2003
				CN	1425203		18-06-2003
				CN	1425204		18-06-2003
				EP	1243032		25-09-2002
				ĒΡ	1243033		25-09-2002
				ĒΡ	1243034		25-09-2002
				EP	1243035		25-09-2002
				WO	0147043	A1	28-06-2001
				WO	0146987	A2	28-06-2001
				WO	0147044	A2	28-06-2001
				WO	0147045		28-06-2001
				JP	2003518332		03-06-2003
				JP	2003518754		10-06-2003
				JP	2003518755		10-06-2003
				JP	2003518756		10-06-2003
				US	2003059984		27-03-2003
				US	2003059975		27-03-2003
				US	2003060038		27-03-2003
				TW	552668	В	11-09-2003